

М.М.Гольдман, В.С.Могилатов

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДИПОЛЯ,
ПОГРУЖЕННОГО В ГОРИЗОНТАЛЬНО-СЛОИСТОЕ
ПОЛУПРОСТРАНСТВО

В последние два десятилетия методы становления поля (СП) получили широкое распространение как в рудной, так и в структурной электроразведке. Как известно, одним из основных преимуществ этих методов перед методами постоянного тока и методами, использующими гармонические поля, является повышенная разрешающая способность, обусловленная более тесной связью неустановившихся полей с геоэлектрическими параметрами объекта поиска. Од-

нако, как показывает анализ теоретических и экспериментальных данных, разрешающая способность существующих модификаций СП не позволяет в ряде случаев эффективно решать поставленные геологические задачи. Например, решение актуальной в настоящее время проблемы поиска водонасыщенных коллекторов на Сибирской платформе наталкивается на ряд серьезных трудностей в районах, где соотношение продольных проводимостей пласта-коллектора и вышележащих отложений относительно невелико ($S_2/S_1 < 0.5$). В этих условиях принципиальное значение приобретает выбор такой модификации, в которой измеряемый сигнал существенно зависит даже от небольших изменений продольной проводимости разреза. Аналогичная проблема имеет место также при поисках малоамплитудных структур фундамента и в ряде других задач структурной электроразведки.

В статье исследуется новая модификация зондирования становлением поля, обладающая в некоторых геоэлектрических моделях в принципе неограниченной разрешающей способностью (точнее, ограниченной только уровнем внешних помех и собственных шумов аппаратуры), использующая в качестве источника первичного поля вертикальный электрический диполь (заземленную линию), который при наземных наблюдениях может быть помещен, например, в скважину, а в варианте морской электроразведки – непосредственно в море.

Здесь уместно подчеркнуть, что использование скважин в предлагаемой модификации необходимо главным образом для размещения вертикальной линии, а не для приближения датчиков поля к объекту поиска, как это имеет место в существующих методах скважинной электрометрии [3]. Поэтому в принципе допустимо использование любых искусственных или естественных полостей в Земле, а также неглубоких скважин, пробуриваемых специально вдоль профиля работ. В последнем случае с энергетической точки зрения может оказаться выгоднее помещать в скважину не питательную, а приемную линии.

Пусть в проводящем слоистом полупространстве помещен вертикальный электрический диполь (ВЭД), момент которого I_z мгновенно уменьшается до нуля. Используя известную методику решения краевой задачи для уравнения теплопроводности с заданными из-

чальными данными и граничными условиями на дневной поверхности, в основании проводящей толщи и на бесконечном удалении от источника по горизонтали, можно получить выражения компонент электромагнитного поля для разреза с произвольным числом границ, подстилаемого изолирующим основанием [4]. Вначале ограничимся рассмотрением трех практически важных моделей среди, а именно двухслойного разреза с непроводящим (а также слабопроводящим) основанием и тонких горизонтов как высокого, так и низкого удельного сопротивления (плоскости Т и S соответственно), расположенных в первом слое двухслойного разреза (рис. I а и I б).

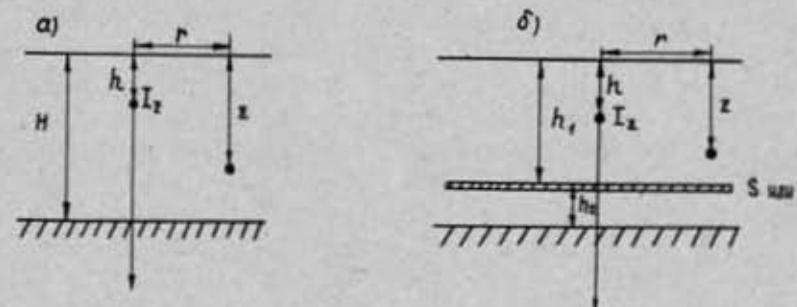


Рис. I

I. Становление поля вертикального электрического диполя (СПВЭД) в двухслойной среде

Выражения для компонент электромагнитного поля, полученных для разреза с изолирующим основанием с помощью методики [4], имеют следующий вид:

(I)

$$H_y = \left\{ I_z / (\pi H^3) \right\} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 t / (4 \mu \sigma)} \sin(\pi n z / H) \int_0^{\infty} m R_n e^{-m^2 t / (4 \mu \sigma)} J_0(mr) dm , \quad (2)$$

$$E_z = \left\{ I_z / (\pi \gamma H^3) \right\} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 t / (4 \mu \sigma)} \sin(\pi n z / H) \int_0^{\infty} m^2 R_n e^{-m^2 t / (4 \mu \sigma)} J_0(mr) dm , \quad (2)$$

$$E_r = \left\{ I_z / (\gamma H) \right\} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi^2 t / (16H^2)} n \cos(\pi n z / H) \int_0^{\pi^2 t / (16H^2)} m R_n e^{-m^2 t / (16H^2)} J_m(m) dm , \quad (3)$$

где γ - удельная проводимость пласта, μ - магнитная проницаемость ($\mu = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м), t - время от момента выключения тока, z и h - глубины погружения точки наблюдения и источника соответственно, H - мощность пласта, R - горизонтальный разнос установки в единицах мощности слоя,

$$R_n = [m \sin(\pi n h / H)] / (m^2 + \pi^2 n^2)$$

Как видно из (1)-(3) с увеличением относительного времени регистрации $t - t_0 / (16H^2)$ влияние слагаемых с номером $n > 2$ ослабевает и в достаточно поздней стадии становления компоненты поля изменяются со временем по экспоненциальному закону:

(4)

$$H_y = \left\{ I_z / (3H^2) \right\} e^{-\pi^2 t / (16H^2)} \sin(\pi z / H) \int_0^{\pi^2 t / (16H^2)} m R_e^{-m^2 t / (16H^2)} J_0(m) dm , \quad (5)$$

$$E_z = \left\{ I_z / (3H^2) \right\} e^{-\pi^2 t / (16H^2)} \sin(\pi z / H) \int_0^{\pi^2 t / (16H^2)} m R_e^{-m^2 t / (16H^2)} J_0(m) dm , \quad (6)$$

$$E_r = \left\{ I_z / (3H^2) \right\} e^{-\pi^2 t / (16H^2)} \cos(\pi z / H) \int_0^{\pi^2 t / (16H^2)} m R_e^{-m^2 t / (16H^2)} J_0(m) dm . \quad (7)$$

Для получения более поздней асимптотики функция R_e в подинтегральных выражениях (4)-(6) разлагается в ряд по малому параметру t и компоненты поля в этом случае выражаются через элементарные функции:

(7)

$$H_y = \left\{ I_z r / (4\pi^2 H^3) \right\} e^{-\pi^2 t / (16H^2)} \sin(\pi z / H) L .$$

$$E_z = \left\{ I_z / (2\pi^2 H^3) \right\} e^{-\pi^2 t / (16H^2)} \sin(\pi z / H) [1 - r^2 \mu / (4t)] L . \quad (8)$$

$$E_r = \left\{ I_z r / (4\pi^2 H^3) \right\} e^{-\pi^2 t / (16H^2)} \cos(\pi z / H) L . \quad (9)$$

$$\text{Здесь } L = \sin(\pi h / H) e^{-r^2 t / (16H^2)} , \quad r = \text{разнос.}$$

Сопоставление со строгими расчетами показывает, что соотношения (4)-(6) удовлетворительно описывают поле, начиная со значений параметра становления $t / H \approx 2$, а выражения (7)-(9) при $t / H > 20$ ($t^2 = 8\pi^2 t / (16H)$).

Таким образом поле ВЭД, в отличие от всех рассматривавшихся ранее источников, в поздней стадии становления описывается экспоненциальной функцией, зависящей от электропроводности и мощности пласта. Эта особенность в поведении неустановившегося поля в принципе позволяет говорить о неограниченной разрешающей способности метода СПВЭД, так как сколь угодно малое изменение проводимости или мощности пласта с увеличением времени приводит к любому, наперед заданному, изменению регистрируемого поля. Естественно, что в реальных условиях, когда возможность измерения малых сигналов ограничена величиной внешних помех и собственных шумов регистрирующей аппаратуры, экспоненциальное затухание поля со временем не позволяет в ряде случаев реализовать отмеченное преимущество метода СПВЭД. В связи с этим практически важно исследовать поведение поля не только в поздней стадии становления, но и на всем протяжении переходного процесса.

Как показывает анализ, представление неустановившегося поля в виде бесконечных сумм (1)-(3) не позволяет эффективно производить расчеты ранних стадий становления, особенно, в случае многослойных сред. Поэтому расчеты неустановившегося поля ВЭД включали два этапа. Вначале поле вычислялось с помощью известного спектрального метода пересчета гармонических полей в нестационарные, а затем использовались асимптотические выражения (4)-(6) для расчета поля в поздней стадии становления. Такая методика позволила уверенно рассчитывать поле при любых временах измерения в разрезах с изолирующим основанием, а также производить расчеты поля в разрезах, подстилаемых средой с конечным удельным сопротивлением.

Выражения, описывающие гармоническое электромагнитное поле ВЭД, были получены для N - слойного разреза при произвольном размещении датчиков поля и, в частности, в рассматриваемой модели среди единственная, отличная от нуля, компонента электрического поля на дневной поверхности имеет вид: [1]:

$$E_r(\omega) = \left\{ I_2 / (2\pi Y_2) \right\} \int_{-\infty}^{\infty} \left[(1 - K_{32} e^{-2\pi \Delta h}) / (1 - K_{32} e^{-2\pi h}) \right] e^{-\lambda h} J_1(\lambda r) d\lambda, \quad (10)$$

где Y_1 и Y_2 — проводимости пласта и основания; $\Delta h = H - h$;

$$K_{32} = (Y_2 P_3 - Y_3 P_2) / (Y_2 P_3 + Y_3 P_2); P_j = [(\lambda^2 - (Y_1 \mu \omega)), j = 2, 3]$$

Исследуем поведение неустановившегося поля в ранней стадии становления. Поскольку источник поля окружен проводящей средой, очевидно, что поле в момент включения тока бесконечно мало. Поэтому в режиме выключения тока в источнике компоненты неустановившегося поля в начальный момент не отличаются от соответствующих компонент на постоянном токе и, в частности, для радиальной составляющей электрического поля в разрезе с изолированным основанием, получаем из (10):

$$E_r^0 = \left\{ I_2 / (2\pi Y_2) \right\} \int_{-\infty}^{\infty} [\operatorname{sh}(\lambda \Delta h) / \operatorname{sh}(\lambda H)] \lambda^2 J_1(\lambda r) d\lambda, \quad (II)$$

или в соответствии с [2], имеем:

$$E_r^0 = \left\{ I_2 \pi / (Y_2 H^3) \right\} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n^2 \sin(\pi n \Delta h / H) K_n (\pi n r / H), \quad (I2)$$

где $K_n(x)$ — модифицированная функция Ганкеля первого порядка.

Отметим, что аналогичное выражение для неустановившегося поля в момент выключения тока можно также получить из соотношения (3) при $t = 0$. Сопоставление со строгими расчетами показывает, что выражение (I2) удовлетворительно описывает поле, пока параметр становления $r/H < 1$. Интересно отметить чрезвычайно быстрое затухание электромагнитного поля в ранней стадии становления по мере удаления от источника в радиальном направлении. Пользуясь известным представлением модифицированных функций Бесселя для больших значений аргумента, получаем выражение для постоянного электрического поля в дальней зоне ($r/H > 1$):

$$E_r^0 = \left\{ I_2 \pi / (Y_2 H^3) \right\} \sin(\pi \Delta h / H) (H / (2r)) e^{-\pi r / H}. \quad (I3)$$

Таким образом в момент выключения тока в источнике электрическая энергия в среде сконцентрирована практически в локальной области, что чисто качественно объясняет отмеченный выше характер затухания поля в поздней стадии становления.

Зависимость измеряемого поля от удельного сопротивления среды в ранней стадии становления незначительна, однако, обращает на себя внимание высокая чувствительность постоянного поля ВЭД в дальней зоне к изменениям мощности проводящей толщи.

С увеличением времени становления возрастает влияние электрических параметров среды, а также чувствительность неустановившегося поля к изменениям глубины залегания изолирующего основания при регистрации переходного процесса в ближней зоне. В табл. I приведены относительные изменения поля ΔE_r , в зависимости от относительных изменений мощности проводящей толщи. В последнем столбце таблицы приведены абсолютные значения поля, возбужденного импульсом тока в линии конечных размеров, замкнутой на верхней и нижней границах пласта ($\frac{r}{H} = 1$).

Таблица I

$\frac{r}{H}$	ΔH	I	2	4	8	16	$E_r H^3 / (I_2 \cdot Y_2)$
4	3	7	14	27	51	0,111 10^{-1}	
4,76	6	12	24	49	102	0,355 10^{-2}	
5,66	9	18	38	83	193	0,739 10^{-3}	
6,73	13	27	58	138	375	0,885 10^{-4}	
8,0	18	39	91	240	808	0,506 10^{-5}	

Из табл. I видно, что более высокая чувствительность поля ВЭД к изменениям мощности пласта, по сравнению с полем, регистрируемым в установке "AB — петля", достигается, начиная со значений параметра становления $\frac{r}{H} \approx 4$. Для того, чтобы оценить порядок измеряемых при этом сигналов необходимо задать конкретные значения параметров среды и установки. Полагая $H = 3000$ м, $Y_2 = 10 \Omega \text{м}$, $I = 30 \text{А}$, $MN = 300$ м, получаем для времен, приведенных в табл. I, следующие величины сигналов в μV : 110; 35; 7; 0,9; 0,05. Таким образом в рассматриваемом примере регистрация сигнала с помощью аппаратуры, применяемой в традиционных модификациях ЗСБЗ, может осуществляться до времен, удовлетворяющих соотношению: $\frac{r}{H} \approx 6,5$. При этом максимальная чув-

Таблица 2

$\frac{h}{H}$	∞	100	80	60	40	20
I	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419
I,19	0,355	0,355	0,356	0,356	0,356	0,356
I,41	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
I,68	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
2	$0,978 \cdot 10^{-1}$	$0,979 \cdot 10^{-1}$	$0,980 \cdot 10^{-1}$	$0,980 \cdot 10^{-1}$	$0,981 \cdot 10^{-1}$	$0,983 \cdot 10^{-1}$
2,38	$0,500 \cdot 10^{-1}$	$0,501 \cdot 10^{-1}$	$0,502 \cdot 10^{-1}$	$0,502 \cdot 10^{-1}$	$0,503 \cdot 10^{-1}$	$0,505 \cdot 10^{-1}$
2,83	$0,227 \cdot 10^{-1}$	$0,228 \cdot 10^{-1}$	$0,229 \cdot 10^{-1}$	$0,229 \cdot 10^{-1}$	$0,230 \cdot 10^{-1}$	$0,232 \cdot 10^{-1}$
3,36	$0,892 \cdot 10^{-2}$	$0,900 \cdot 10^{-2}$	$0,902 \cdot 10^{-2}$	$0,903 \cdot 10^{-2}$	$0,911 \cdot 10^{-2}$	$0,929 \cdot 10^{-2}$
4	$0,288 \cdot 10^{-2}$	$0,293 \cdot 10^{-2}$	$0,294 \cdot 10^{-2}$	$0,296 \cdot 10^{-2}$	$0,300 \cdot 10^{-2}$	$0,311 \cdot 10^{-2}$
4,76	$0,713 \cdot 10^{-3}$	$0,733 \cdot 10^{-3}$	$0,738 \cdot 10^{-3}$	$0,747 \cdot 10^{-3}$	$0,765 \cdot 10^{-3}$	$0,822 \cdot 10^{-3}$
5,66	$0,121 \cdot 10^{-3}$	$0,127 \cdot 10^{-3}$	$0,129 \cdot 10^{-3}$	$0,131 \cdot 10^{-3}$	$0,137 \cdot 10^{-3}$	$0,158 \cdot 10^{-3}$
6,73	$0,108 \cdot 10^{-4}$	$0,119 \cdot 10^{-4}$	$0,122 \cdot 10^{-4}$	$0,128 \cdot 10^{-4}$	$0,141 \cdot 10^{-4}$	$0,192 \cdot 10^{-4}$

$$E_r = \left\{ I_z / (\pi h^3) \right\} \sum_j [K_j \cos(K_j z/h) R_j e^{-K_j t/(10h)}] \int_0^h \mu_j J_1(mr) dm , \quad (I5)$$

где

$$R_j = \sin(K_j h/h_i) / \{ \cos^2(K_j) [1/\cos^2(K_j) + h_i/(h_i \cos^2(K_j h_i/h_i)) * S/S_i] \} ;$$

$$\mu_j = m^2 \exp(-m^2 t / (\pi \mu h_i)) / (m^2 * k_j^2); \quad r = r/h_i .$$

Коэффициенты k_j удовлетворяют трансцендентному уравнению $tq(K_j) + tq(K_j h_i/h_i) = -k_j S/S_i$, из которого видно, что они монотонно возрастают с увеличением номера j . Таким образом, поле ВЭД в рассматриваемой модели среди, как и в случае двухслойного разреза с изолирующим основанием, в поздней стадии становления изменяется по экспоненциальному закону, причем показатель экспоненты зависит от всех геоэлектрических параметров среды. Это позволяет ожидать повышенной разрешающей способности метода СПВЭД к выявлению низкоомных маломощных горизонтов в разрезе, по сравнению с существующими модификациями ЗСБ. Стро-

II. Становление поля ВЭД в пласте, содержащем "плоскость S"

Выражение для радиальной компоненты электрического поля имеет следующий вид:

гие расчеты поля, приведенные для рассматриваемой модели среды подтверждают этот вывод. В качестве примера на рис. 2 приведены графики неустановившегося поля ВЭД в земле, регистрируемого в установке "АВ-петля", (пунктирные линии) для различных соотношений продольной проводимости "плоскости S" и вышележащих отложений. В обоих случаях поле в среде, содержащей "плоскость S" нормируется полем в двухслойном разрезе с изолирующими основаниями. Из рис. 2 видно, что относительное поле ВЭД в поздней стадии становления экспоненциально возрастает с увеличением времени, тогда как поле, измеряемое в установке "АВ-петля", стремится к постоянному значению, равному $(1 + S)/(1 + H)$.

Интересно отметить, что поле ВЭД более чувствительно к появлению в разрезе тонкого низкоомного горизонта не только в поздней стадии становления, но практически во всем временном диапазоне, в котором "плоскость S" проявляется на кривых зондирования. Таким образом, для фиксированного момента времени относительное поле ВЭД всегда больше, чем поле, измеряемое в установке "АВ-петля". Однако практически важно сопоставить разрешающие способности сигналов, регистрируемых в каждой из установок для своего момента времени, например, такого, при котором измеряемый сигнал превышает минимально допустимый для используемой аппаратуры уровень. Полагая этот уровень равным $1 \mu\text{V}$ и выбирая параметры среди и установок такими же, как и в первом примере (в установке "АВ-петля" сторону петли положим равной 500 м), получим следующие относительные значения поля в зависимости от соотношения продольных проводимостей "плоскости S" и вышележащих отложений:

таблица 3

типа установки	S_1/S_2	I	I/2	I/4	I/8
"АВ-петля"	2,6	I,6	I,2	I,I	
ВЭД	4,8	2,5	I,6	I,3	

Из табл. 3 видно, что в рассматриваемых геоэлектрических условиях реальная разрешающая способность поля ВЭД выше по срав-

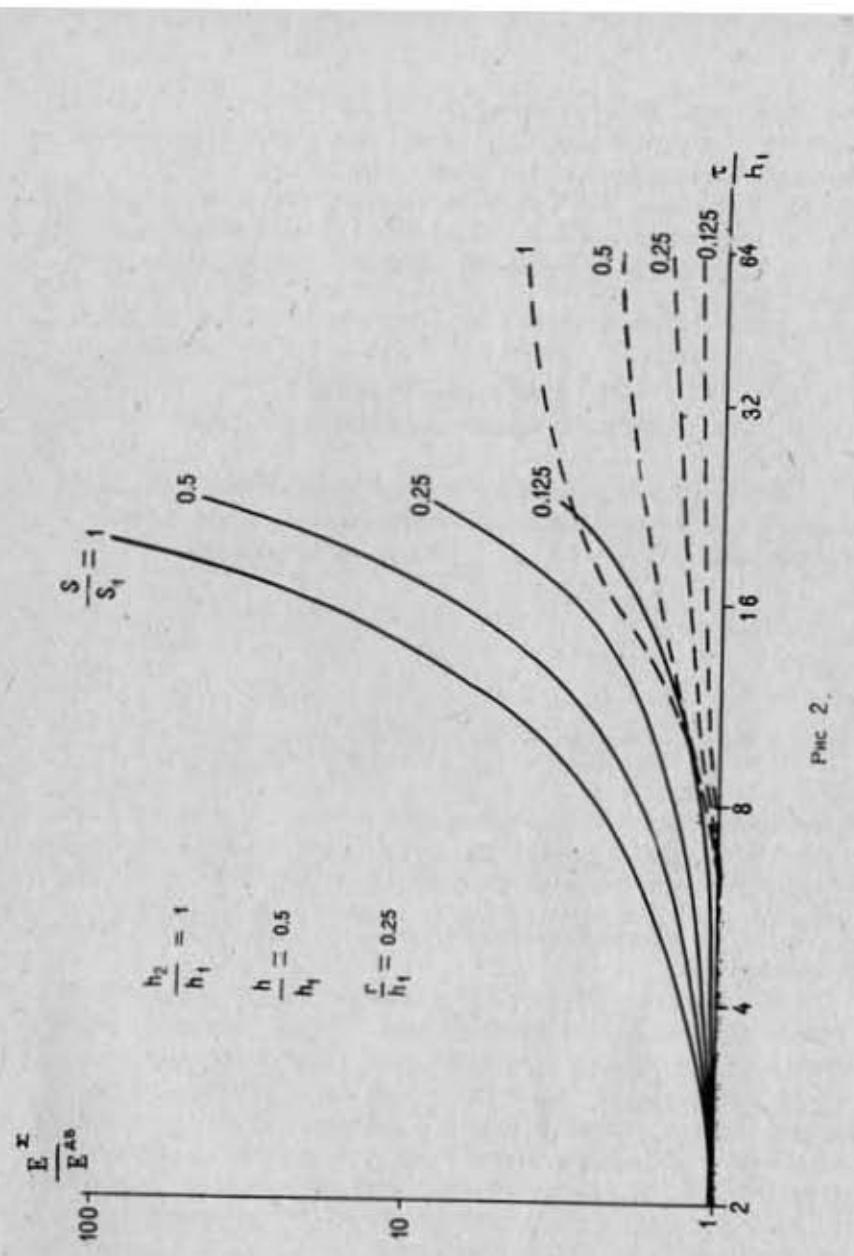


Рис. 2

нению с полем, регистрируемым установкой "AB-петля" и это преимущество особенно ощутимо при выкли или относительно слабо проводящих или маломощных горизонтов. Если же значения $\frac{S}{S_1} > 1$, влияние "пластины S" значительно при регистрации компоненты B_z от горизонтальной заземленной линии и усложнение методики работ, связанное с применением вертикальной линии, едва ли целесообразно.

III. Становление поля ВЭД в присутствии тонкого высокомоментного экрана

Выражение для радиальной компоненты электрического поля в пласте, содержащем бесконечно тонкий горизонт с поперечным сопротивлением $T(T = h_r \cdot \rho_r)$, имеет следующий вид:

$$E_r = \left\{ I_z / \pi Y_1 h_1^3 \right\} \int R(m) e^{-vt/\gamma_1 \mu h_1^2} J_1(mr) dm; \quad (I6)$$

$$R(m) = \frac{m^2 k_1}{m^2 + k_1^2} \frac{\cos(k_1 z/h_1) \sin(k_1 h_1/h_1)}{\sin^2 k_1 [1/\sin^2 k_1 + h_2/h_1 \sin^2(k_2 h_2/h_1) - \text{ctg}(k_1 z/h_1) \text{ctg}(k_2 h_2/h_1)/h_1^2]}, \quad (I7)$$

$$K_1 \text{ctg}(K_1) + K_2 \text{ctg}(K_2 h_2/h_1) \frac{Y_1}{h_1} \cdot (T/T_1)m^2 = 0; K_1 = (\gamma_1 \frac{Y_1}{h_1} - m^2); i=1/2 \quad (I8)$$

γ_1 и γ_2 - электропроводности пород над экраном и под экраном соответственно.

Как видно из (I8) при любом, сколь угодно большом, но конечном значении $\frac{T}{T_1}$, регистрируемое поле в достаточно поздней стадии становления ($t \rightarrow \infty, m \rightarrow 0$) практически не искается при отсутствии тонкого низкомоментного горизонта. Однако, учитывая весьма быстрое затухание поля ВЭД в поздней стадии становления, на практике эти времена могут оказаться недостижимыми из-за малости сигнала, и, следовательно, экранирование может иметь место и при конечных значениях поперечного сопротивления высокомоментного горизонта. В связи с этим приобретает интерес исследование

неустановившегося поля во всем временном диапазоне. Результаты расчетов, выполненные как спектральным методом, так и с помощью соотношений (I6)-(I8) представлены на рис. 3 и 4 в виде отношения поля в среде, содержащей "плоскость T", к нормальному полю, когда экран отсутствует и $\rho_r \rightarrow \infty$. Из сопоставления рис. 3 и рис. 4 видно, что при расположении источника поля над "плоскостью T" экранирование нижележащих отложений наблюдается до значительно более поздних времен, чем при расположении электрического диполя под экраном ($\frac{Y_1}{h_1} = 9,5$ и $5,6$, соответственно). Для этих значений параметра становления в табл. 4 приведены величины сигналов на дневной поверхности, нормированные множителем $h_1^3 / I_z \cdot \rho_1$.

Таблица 4

$\frac{h_1}{\rho_1}$	I	I/2	I/4	I/8	I/16
Диполь над экраном	$0,427 \cdot 10^{-5}$	$0,911 \cdot 10^{-5}$	$0,157 \cdot 10^{-4}$	$0,193 \cdot 10^{-4}$	$0,189 \cdot 10^{-4}$
Диполь под экраном	$0,421 \cdot 10^{-3}$	$0,973 \cdot 10^{-3}$	$0,176 \cdot 10^{-2}$	$0,242 \cdot 10^{-2}$	$0,271 \cdot 10^{-2}$

Как видно из табл. 4, расположение одного из датчиков поля в подэкраниной толще является эффективным средством уменьшения влияния высокомоментных горизонтов и при исследовании геоэлектрических параметров закранированной среды эквивалентно существенному повышению измеряемого сигнала (примерно на два порядка).

ЛИТЕРАТУРА

1. ГАСАНЕНКО Л.Б., МАРКИНА Е.А. Электромагнитное поле низкочастотного диполя в горизонтально-слоистой среде. - Уч. записки АГУ. Серия физ. и геол. наук, 1967, № 333, вып. 17, с. 201-226.

2. ДИТКИН В.А., ПРУДНИКОВ А.П. Интегральные преобразования и операционное исчисление. М., Физматгиз, 1961, 524 с.

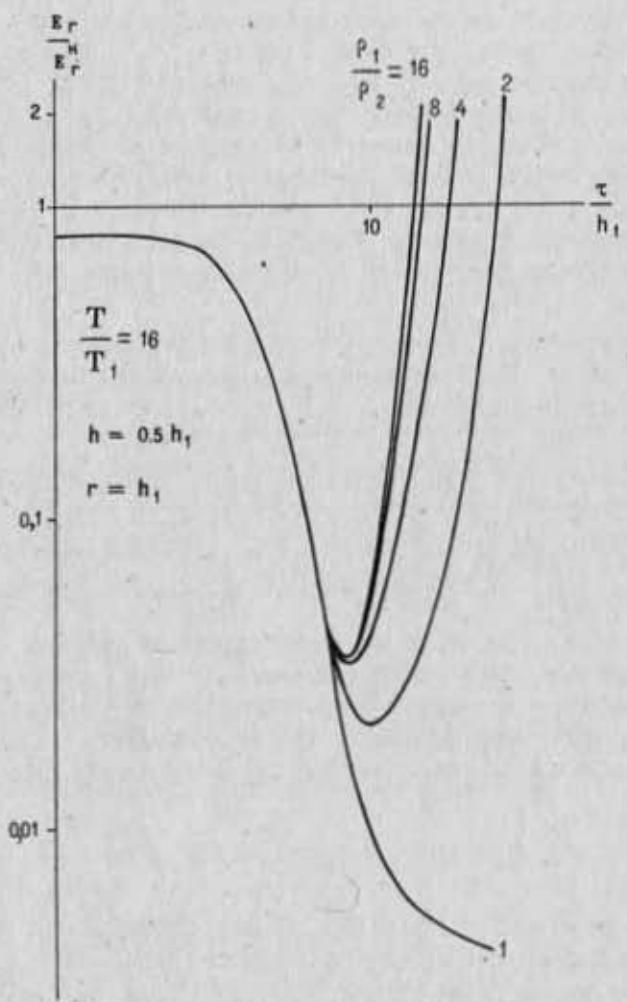


Рис. 3

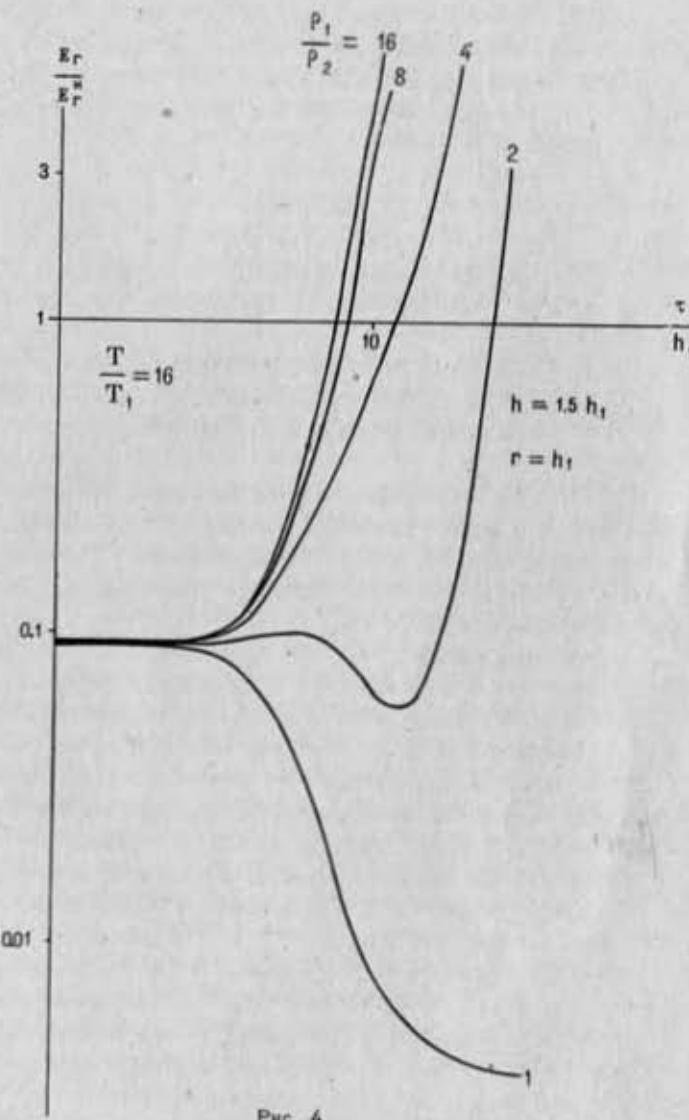


Рис. 4

3. ИВАНЧУК А.М., КОГАН В.Д., СИДОРСКИЙ С.А.
Способ геозондирования. Авт. свид. № 396654, 1971.
4. ТИХОНОВ А.Н., СКУТАРЕВСКАЯ О.А. О становлении электрического тока в неоднородной среде.- "Изв. АН СССР. Серия геофиз.", 1950, № 4, с. 281-293.